

イオンスパッタコーティング装置 E-1030

製造元	株式会社日立ハイテク
仕様	放電方式：ダイオード放電マグネトロン形 ターゲット材料：Pt-Pd、Au-Pd から選択 試料サイズ：最大直径 55mm、最大高さ 20mm
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・地下 1 階 002 室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko
注意事項等	事前講習を受講のうえ、利用者自身で操作してください。 試料情報（組成、形状、個数）を下記連絡先にお知らせください。
連絡先	材料工学専攻 教育研究支援室 技術職員 佐々木 宣治 075-753-5426 sasaki.nobuharu.7a (at) kyoto-u.ac.jp
キーワード	イオンスパッター、導電性コーティング、Pt-Pd、Au-Pd
機器コード	0000103016
自由記入欄	電子顕微鏡による観察や元素分析を行う際に、試料表面に導電性コーティングを施すための前処理装置です。コーティング材料として Pt-Pd（または Au-Pd）を使用しています。準備、真空引き、コーティング、後片付けを含めた所要時間は、おおよそ 30 分程度と簡便に行えますが、EDX による元素分析で試料含有元素に加えて Pt と Pd（あるいは Au と Pd）のピークが検出されるようになりますのでご注意ください。元素分析を行う場合は、本装置でのスパッタコーティングよりも、真空蒸着装置を用いたカーボンコーティングの方が適している場合があります。

